

静電チャック管理システム

Electrostatic Chuck Monitoring System

ウェハ吸着状態のモニタリング

Monitoring of wafer adsorption state

静電チャックとワークの吸着状態を感知する管理システム
Control system continuously monitors the condition of ESC and Si-wafer by connecting between ESC and the control power supply.

特長 Feature

- 吸着状態を常時モニタリングする事で、静電チャックの吸着状態を感知する事が可能です。真空装置内での在荷確認や、吸着の状態、ウェハ離脱時の除電レシピの選定等に活用することが可能です。

By constantly monitoring the adsorption state, possible to sense the adsorption state of the electrostatic chuck. It can be used for checking wafer on or off in the vacuum system, checking the state of adsorption, selecting static elimination recipe when leaving the wafer, and so on.

- 静電チャックや電源の改造が不要なため、既存設備にセンサ機能を付与することが可能です。

Option to add sensor function to ESC with no need to modify ESC or power supply.

- 制御系にデジタル出力とアナログ出力を持ち、各種制御機器へのフィードバックが可能です。

Easy to communicate with the production equipment due to having I/O (2 digital and 1 analog outputs) on the control system

